Catégorie de procédés raffinés	Gaz *i*										
	CF_4	C_2F_6	CHF_3	CH_2F_2	C_3F_8	$c\text{-}C_4F_8$	NF_3	SF_6	C_4F_6	C_5F_8	C_4F_8O
MODELAGE DES CONTOURS/GRAVURE											
Gravure à l'oxyde											
$1\text{-}U_i$	0,2-0,8	0,2-0,7	0,2-0,7	0,02-0,3	S. O.	0,1-0,3	0,1-0,4	0,1-0,4	0,05-0,2	0,05-0,3	S. O.
PCF_4	S. O.	0,05-0,5	0,01-0,8	0,05-0,1	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,4	0,02-0,4	S. O.
PC_2F_6	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,3	0,02-0,3	S. O.
PC_3F_8	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
Gravure du nitrure											
$1\text{-}U_i$	0,2-0,8	0,2-0,7	0,2-0,7	0,02-0,3	S. O.	0,1-0,3	0,1-0,4	0,1-0,4	0,05-0,2	0,05-0,3	S. O.
PCF_4	S. O.	0,05-0,5	0,01-0,8	0,05-0,1	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,4	0,02-0,4	S. O.
PC_2F_6	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,3	0,02-0,3	S. O.
PC_3F_8	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
Gravure du silicium											
$1\text{-}U_i$	0,2-0,8	0,2-0,7	0,2-0,7	0,02-0,3	S. O.	0,1-0,3	0,1-0,4	0,1-0,4	0,05-0,2	0,05-0,3	S. O.
PCF_4	S. O.	0,05-0,5	0,01-0,8	0,05-0,1	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,4	0,02-0,4	S. O.
PC_2F_6	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,3	0,02-0,3	S. O.
PC_3F_8	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
Gravure du métal											
$1\text{-}U_i$	0,2-0,8	0,2-0,7	0,2-0,7	0,02-0,3	S. O.	0,1-0,3	0,1-0,4	0,1-0,4	0,05-0,2	0,05-0,3	S. O.
PCF_4	S. O.	0,05-0,5	0,01-0,8	0,05-0,1	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,4	0,02-0,4	S. O.
PC_2F_6	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,3	0,02-0,3	S. O.
PC_3F_8	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
NETTOYAGE DES CHAMBRES											
Nettoyage de système au plasma interne											
$1\text{-}U_i$	0,8-0,95	0,4-0,8	S. O.	S. O.	0,2-0,6	0,05-0,3	0,05-0,3	S. O.	S. O.	0,05-0,2	0,05-0,2
PCF_4	S. O.	0,05-0,2	S. O.	S. O.	0,05-0,2	0,05-0,2	0,05-0,2	S. O.	S. O.	0,05-0,2	0,05-0,2
PC_2F_6	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
PC_3F_8	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,02-0,08
Nettoyage de système au plasma séparé											
$1\text{-}U_i$	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
PCF_4	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
PC_2F_6	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
PC_3F_8	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
Nettoyage de système de chaleur interne											
$1\text{-}U_i$	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
PCF_4	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
PC_2F_6	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
PC_3F_8	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
NETTOYAGE DES TRANCHES											
Nettoyage de chant											
$1\text{-}U_i$	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
PCF_4	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
PC_2F_6	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
PC_3F_8	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
Calcination											
$1\text{-}U_i$	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
PCF_4	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
PC_2F_6	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
PC_3F_8	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.